

# 2009年3月期第2四半期決算説明会

2008年11月13日

株式会社ホロン

JQ7748

Solutions for Mask & Wafer Metrology

# INDEX

1. 2009年3月期第2四半期決算の概要
2. 2009年3月期の業績見通し
3. 事業計画を達成するための施策
4. 今期の重点施策

# 1. 2009年3月期第2四半期決算の概要

# 第2四半期損益(対予想比)

(単位:百万円)

	当初予想	08年9月期	対予想比	
	金額	金額	増減額	増減比(%)
売上高	370	104	△ 266	△ 71.9%
営業利益	△ 16	△ 459	△ 443	—
経常利益	△ 16	△ 473	△ 457	—
四半期純利益	△ 17	△ 482	△ 465	—

当初予想:平成20年5月13日に公表した数値を使用しております。

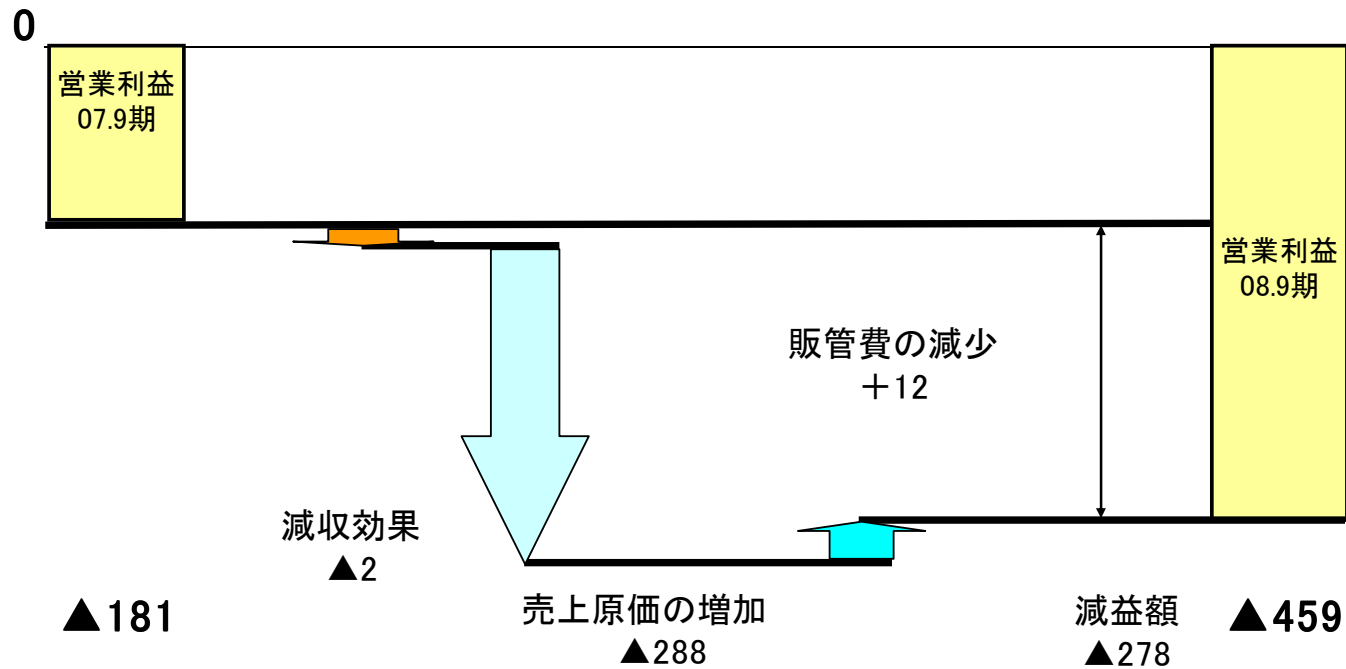
# 第2四半期損益(対前期比)

(単位:百万円)

	07年9月期		08年9月期		対前年同期比	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)	増減額	増減比(%)
売上高	106	100.0%	104	100.0%	△ 2	△1.9%
売上総利益	34	32.9%	△ 255	△245.6%	△ 289	—
販売費及び一般管理費	216	203.7%	203	195.2%	△ 13	△6.0%
営業利益	△ 181	△170.8%	△ 459	△441.2%	△ 278	—
経常利益	△ 180	△170.1%	△ 473	△454.6%	△ 293	—
四半期純利益	△ 386	△363.8%	△ 482	△462.7%	△ 96	—

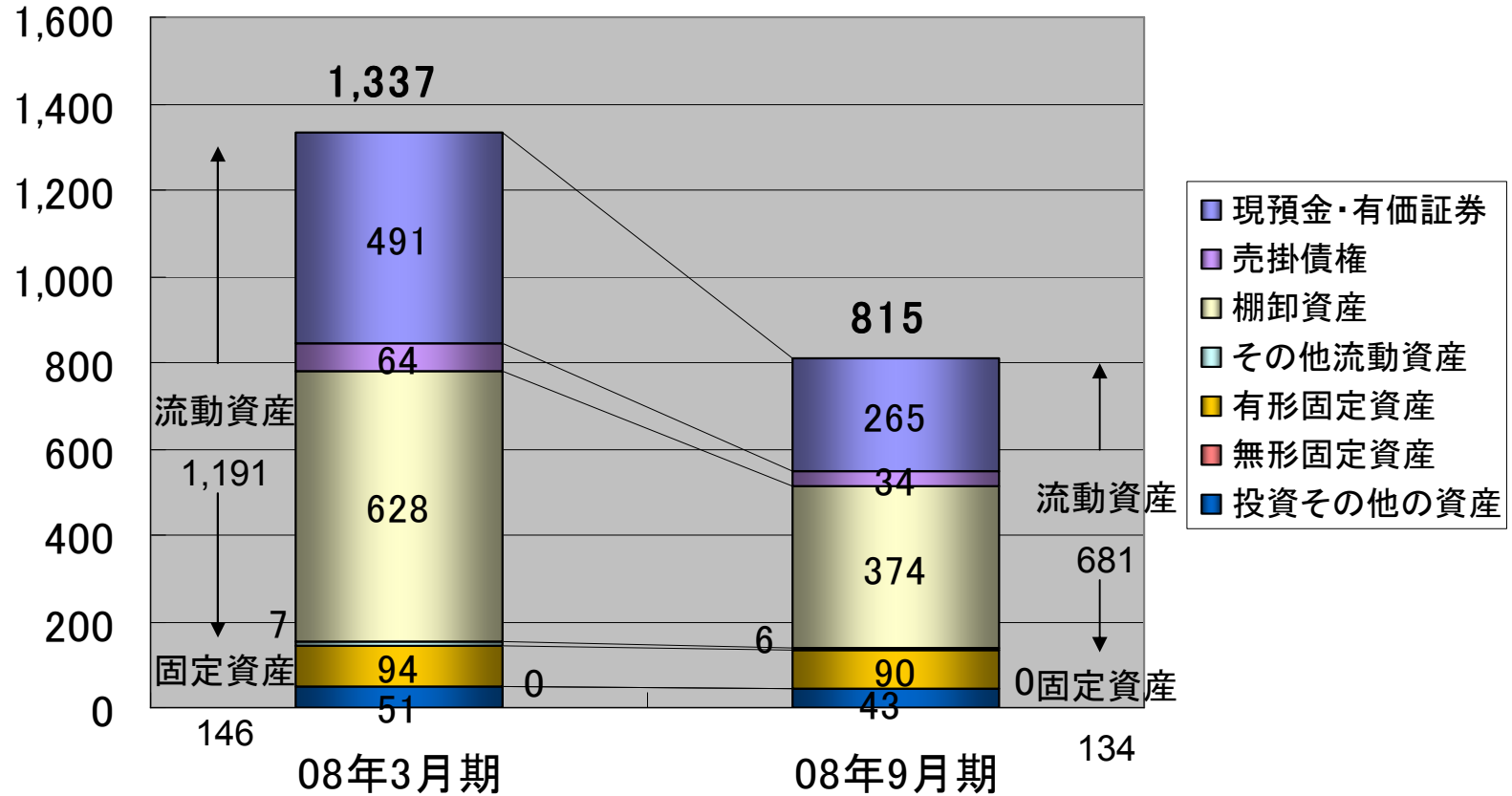
# 第2四半期営業利益 対前年同期比増減要因

単位：百万円



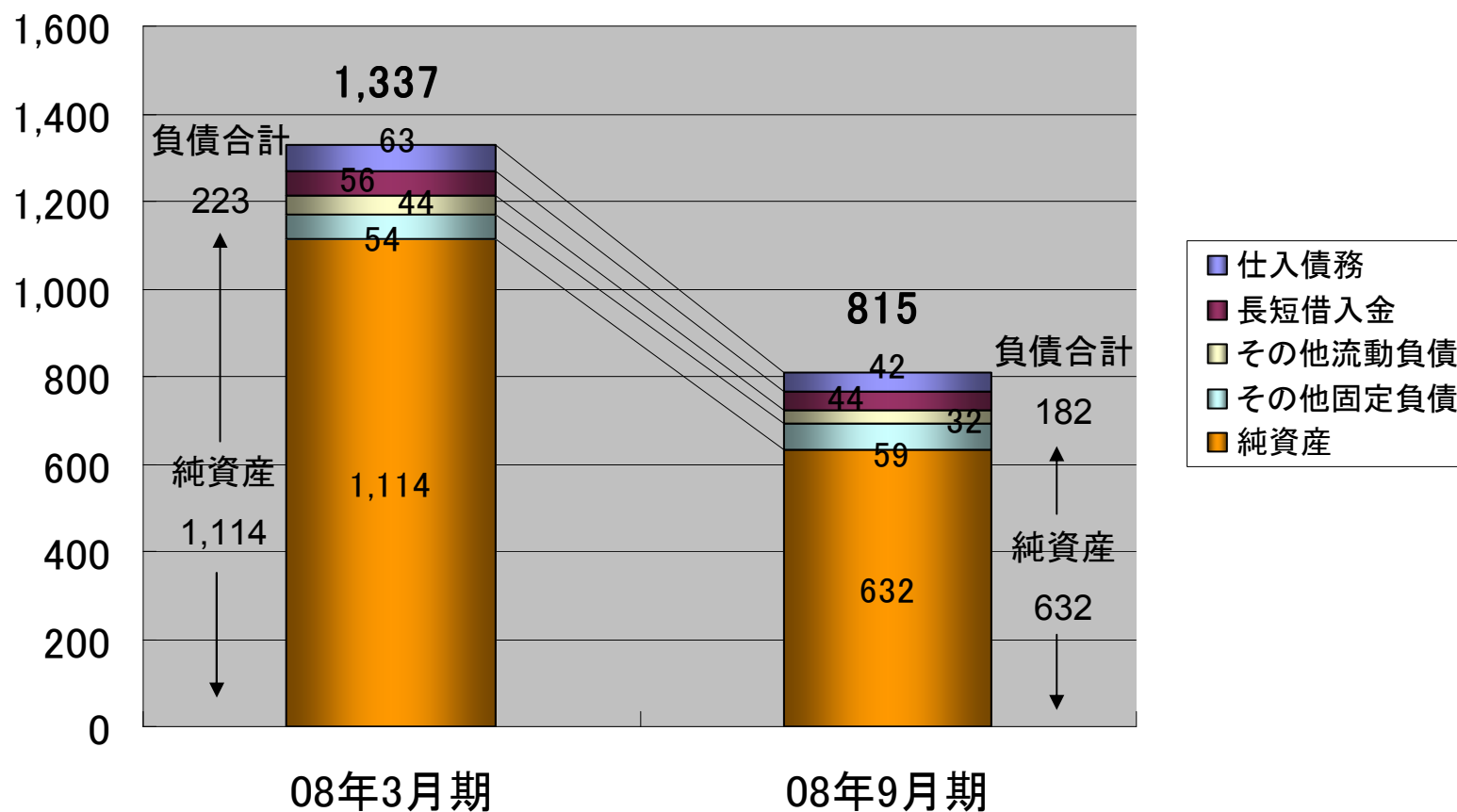
# 資産の状況

単位:百万円



# 負債・資本の状況

単位:百万円





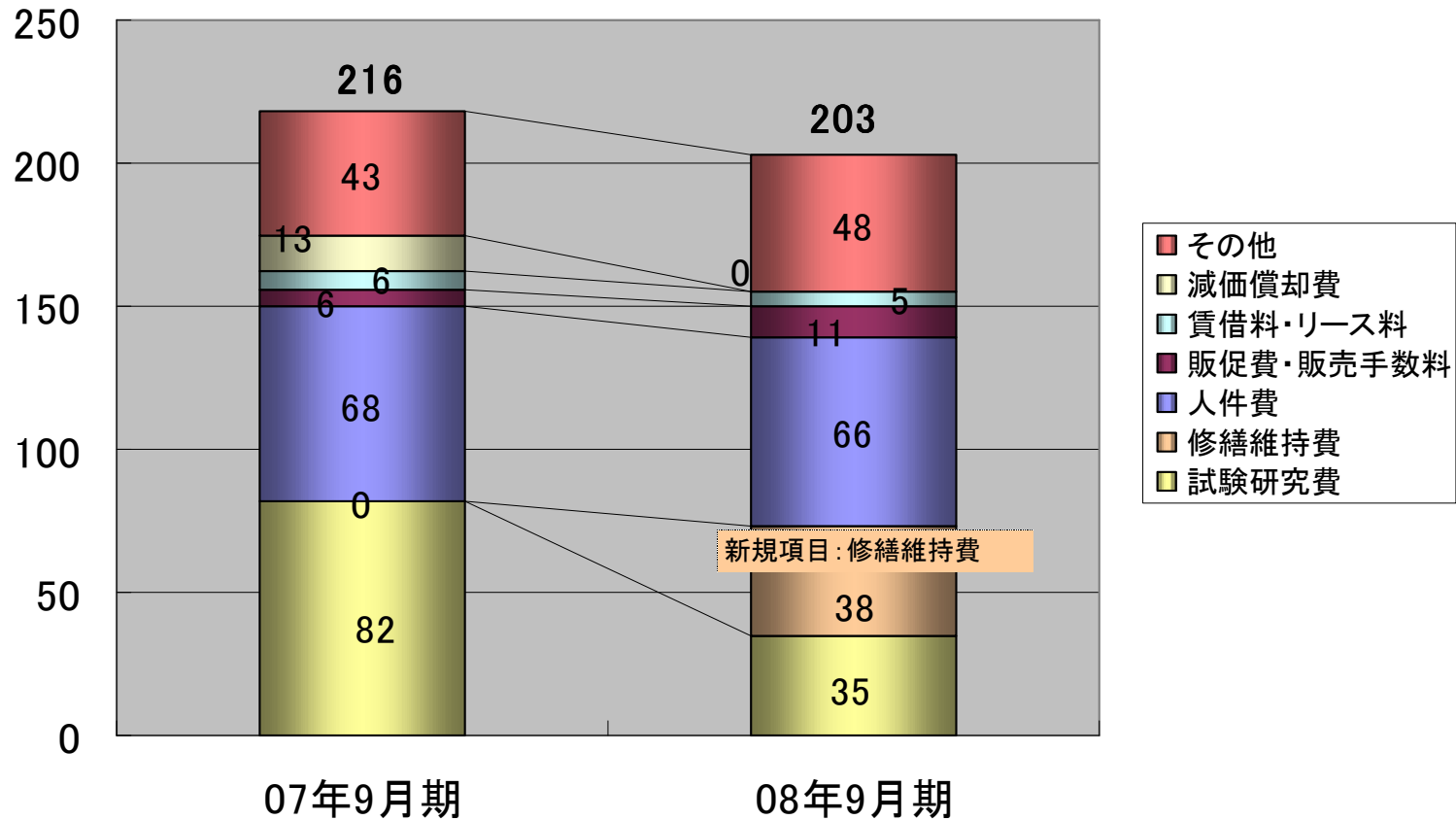
# キャッシュフローの状況

(単位:百万円)

	07年9月期	08年9月期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 176	△ 200	△ 24
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20	△ 6	14
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 83	△ 11	72
現金及び現金同等物の増加額	△ 280	△ 226	54
現金及び現金同等物の四半期末残高	345	265	△ 80

# 販管費の状況

単位:百万円



## 2. 2009年3月期業績見通し

# 業績見通し

(単位:百万円)

	前期実績	09/3期予想	増減額	増減率	08/9期
売上高	306	870	564	184.3%	104
営業利益	△ 326	△ 264	62	—	△ 459
(売上高比)	△106.7%	—	—	—	—
経常利益	△ 343	△ 278	65	—	△ 473
(売上高比)	△112.2%	—	—	—	—
当期純利益	△ 409.0	△ 287	122	—	△ 482
(売上高比)	△133.9%	—	—	—	—

### 3. 事業計画を達成するための施策

- (1) 「EMUの性能アップ(競争力)と新規市場開拓」
- (2) 「台湾・中国市場の見直し」
- (3) 「電子スタンパーの高輝度LED市場への販売」

# 3-1. EMUの性能アップ(競争力) と新規市場開拓

## 1. EMU-270Aは、32nmノード以降の性能に対応

2. ナノインプリントのテンプレート用検査  
10月のBACUSシンポジウムでEMI社から「Inspection 32nm  
Imprint Masks」が発表された。

# HOLON Mask CD-SEM ロードマップ

Year	2007	2008	2009	2010	2011
ITRS 技術ノード(量産)	65nm	57nm	50nm	45nm	40nm
ITRS 技術ノード(開発)	45nm		32nm		22nm
型式	EMU-270				
		EMU-270A			
			EMU-xxx		
				EMU-xxxx	
ダイナミック再現性	0.6nm	0.45nm		0.3nm	
装置開発計画	32nm	22nm			
	チャージ対策 Wind-SEM (Low Vacuum)				
		収差補正器付き: Resolution 1.5nm(1kv)			
				高精度位置決めステージ	
				ナノインプリント対応	
完全自動測定化 "EMU-Navi"	"CD-Master"				
		"Pattern Master" (2D測定)			
		"Nano-pede" (多点任意形状測定)			

3年先を見つめた技術開発が継続されています

## 3-1. EMUの性能アップ（競争力） と新規市場開拓

1. EMU-270Aは、32nmノード以降の性能に対応

### 2. ナノインプリントのテンプレート用検査

10月のBACUSシンポジウムでMII社から「 Inspection 32nm Imprint Masks 」で発表された。



# Bacusで発表



Molecular Imprints

## Inspection of 32nm Imprint Masks

Kosta Selinidis, Ian McMackin, Ecron Thompson, Doug Resnick  
Molecular Imprints, Inc.  
1807 West Braker Lane, Austin, TX 78758

October 9, 2008

# Inspection 32nm Imprint Masks

## Mask and Imprint Analysis

▶ SEMs of the Mask were captured with a Holon EMU-270A SEM

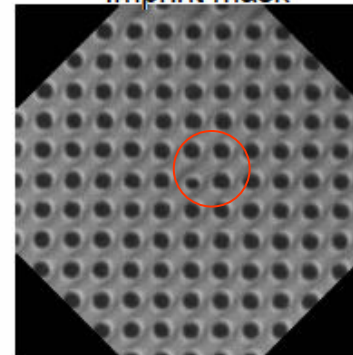
- 1.5 nm resolution at 1.0 kV when applying aberration correction.
- Low vacuum and charge control enable high quality imaging on fused silica masks.



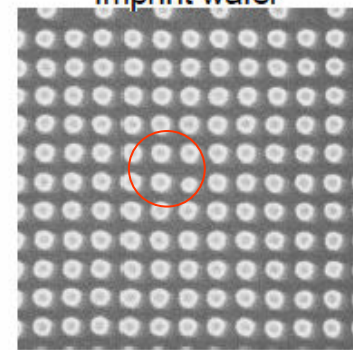
HOLON

## 32nm Pillar image comparisons

Imprint mask



Imprint wafer



32nm Pillar programmed defect Size 3: 12nm data size

EMU-270A

## 3-2.台湾・中国市場の見直し

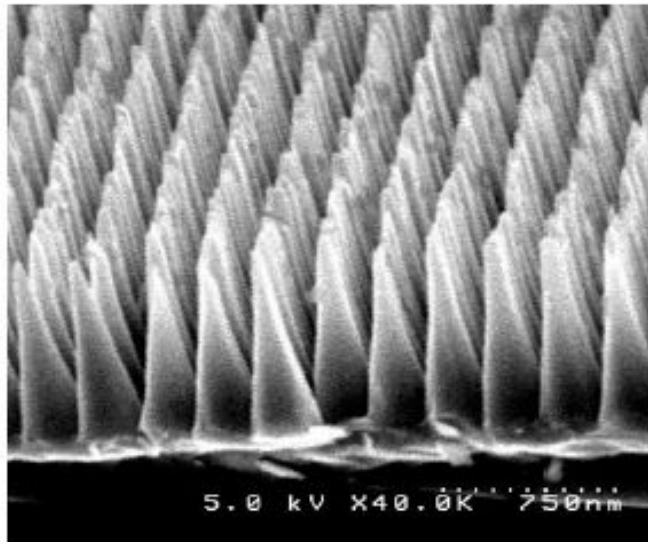
1. 中国市場はMIC社と新代理店契約を締結
2. 45nm/65nmノードに対応したEMU-270は製造コストの低減を図り、低価格で販売。

## 3-3.電子スタンパーの高輝度LED 市場への販売

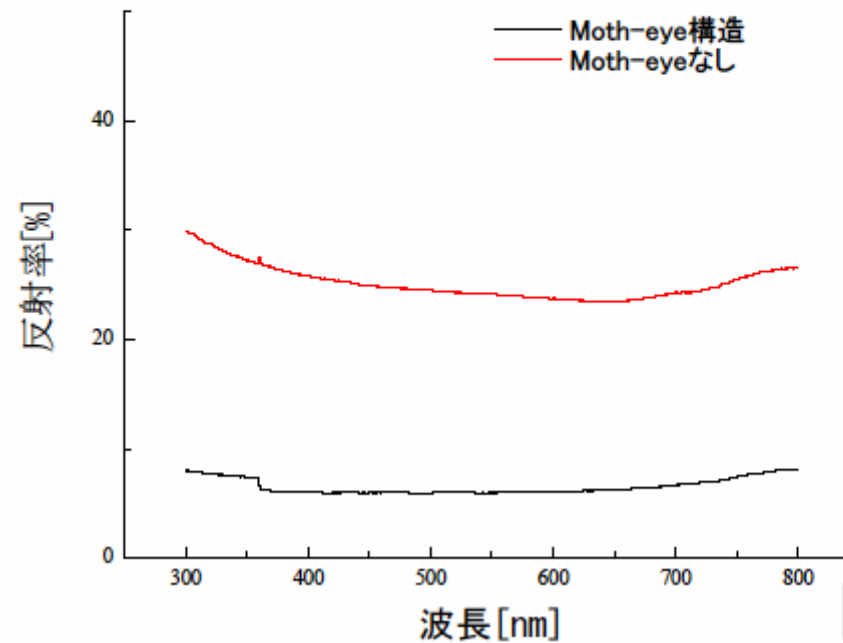
1. LEDの光り取り出し効率において成果  
が得られた。
2. ソリューションの共同開発

# Moth-eye構造

## 反射率スペクトル測定結果



鳥瞰電子顕微鏡像(40,000倍)



(株式会社エルシード様 ご提供)

HOLON

## 3-3.電子スタンパーの高輝度LED 市場への販売

1. LEDの光り取り出し効率において成果  
が得られた。
2. ソリューションの共同開発  
マスクメーカーとレジストメーカーとの協力

## 4. 今期の重点施策

1. 受注優先
2. 予算管理の徹底
3. 株式会社エー・アンド・デイとの共同開発

# 業績見通しの開示について

- 本資料に記載されている内容は、現時点で入手可能な情報に基づき予測したものであり、下記のリスク等や不確定要因等を含んだものであることをご了承願います。また、新たな情報、将来の事象、その他の結果に関わらず、常に株式会社ホロンが将来の見直しを見直すとは限りません。
- 当社の製品については国内販売については検収基準、海外については船積基準を原則として売上を計上しております。本資料における売上見込みは現時点での進捗見込みに基づくものであり、検収が遅れるリスクを含んでおります。
- また、当社を取り巻く経済情勢、株式市場動向等により、実際の業績等が経営目標その他の見通しと異なる結果となる可能性もあります。